

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年5月11日(11.05.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/079856 A1

- (51) 国際特許分類:
G11B 5/851 (2006.01) *G11B 5/65* (2006.01)
C23C 14/34 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2022/035488
- (22) 国際出願日: 2022年9月22日(22.09.2022)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2021-181296 2021年11月5日(05.11.2021) JP
- (71) 出願人: J X 金属株式会社 (JX NIPPON MINING & METALS CORPORATION) [JP/JP];
〒1058417 東京都港区虎ノ門二丁目1
0番4号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 小庄 孝志(KOSHO, Takashi); 〒3191535
茨城県北茨城市華川町白場187番地4 J
X金属株式会社磯原工場内 Ibaraki (JP). 岩
淵 靖幸(IWABUCHI, Yasuyuki); 〒3191535 茨城
県北茨城市華川町白場187番地4 J X金
属株式会社磯原工場内 Ibaraki (JP).
- (74) 代理人: アクシス国際弁理士法人 (AXIS
PATENT INTERNATIONAL); 〒1050004 東京
都港区新橋二丁目6番2号 新橋アイ
マークビル Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP,
KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK,
LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW,
MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE,
PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD,
SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT,
TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS,
MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,
TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS,
SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告(条約第21条(3))



WO 2023/079856 A1

(54) **Title:** SPUTTERING TARGET MEMBER, SPUTTERING TARGET ASSEMBLY, AND FILM FORMING METHOD

(54) 発明の名称: スパッタリングターゲット部材、スパッタリングターゲット組立品、及び成膜方法

(57) **Abstract:** Provided is a sputtering target member which is for a magnetic recording layer and can suppress the generation of particles. This sputtering target member for a magnetic recording layer contains 10-70 mol% of Co, 5-30 mol% of Pt, 1.5-10 mol% of carbide, and 0-30 mol% in total of one or two more non-magnetic materials selected from among carbon, oxide, nitride, and carbonitride.

(57) 要約: パーティクルの発生を抑制可能な、磁気記録層用スパッタリングターゲット部材を提供する。Coを10~70mol%、Ptを5~30mol%、炭化物を1.5~10mol%、且つ、炭素、酸化物、窒化物及び炭窒化物から選択される一種又は二種以上の非磁性材料を合計で0~30mol%含有する磁気記録層用スパッタリングターゲット部材。